# Влияние примесей бора, азота, кислорода на электронную структуру и деформационное поведение Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>

© Н.И. Медведева

Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия E-mail: medvedeva@ihim.uran.ru

### (Поступила в Редакцию 17 июля 2012 г.)

В рамках неэмпирического метода функционала электронной плотности изучено влияние примесей азота, кислорода и бора на параметры решетки, локальные искажения, стабильность и электронную структуру тройного силикокарбида Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>. Проведено моделирование аксиального растяжения и установлено влияние примесей на деформационное поведение Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>. Показано, что азот может способствовать упрочнению Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>, а бор и кислород должны приводить к ламинатному расслоению.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 10-03-96015).

## 1. Введение

Силикокарбид Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> характеризуется тугоплавкостью, стойкостью к агрессивным средам, пластичностью при высоких температурах, что позволяет отнести эту слистую MAX-фазу к новым перспективным композиционным материалам [1–3]. Это соединение демонстрирует свойства металлов (электрическая проводимость и теплопроводность у Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> значительно выше, чем у металлического Ti) и керамики (хрупкопластичный переход в Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> происходит при высокой температуре 1100°C) [1–11].

Необычные механические свойства  $Ti_3SiC_2$  обусловлены сложным механизмом деформации, где скольжение и ламинатный разрыв являются доминирующими. Микроскопический механизм хрупкого разрушения в  $Ti_3SiC_2$  исследовался в рамках неэмпирических методов [12–15]. Как известно,  $Ti_3SiC_2$  имеет гексагональную слоистую структуру из чередующихся плоских сеток атомов кремния и карбидных блоков [TiC]. Сравнение энергий разрыва и сдвига для различных базисных плоскостей показало, что расслаивание и планарные сдвиги в карбидных блоках являются маловероятными, а образование трещин и скольжение должны происходить между слоями атомов Ti и Si.

Установлено, что в отличие от металлов примеси легких атомов не оказывают большого влияния на движение дислокаций в  $Ti_3SiC_2$ . Такой эффект возможен в случае, когда примеси находятся в структурном блоке [TiC], а не являются примесями внедрения между гексагональными слоями атомов Ti и Si. Несмотря на большой интерес, механизм влияния легких примесей на кристаллическую структуру и электронное строение  $Ti_3SiC_2$  недостаточно исследован. Твердые растворы Ti3SiCN и Ti3SiCO, где атомы углерода частично замещаются азотом или кислородом, моделировались в работе [16], однако предпочтительные позиции легких примесей, а также их влияние на параметры решетки и деформационное поведение не были установлены. В настоящей работе в рамках неэмпирического метода функционала электронной плотности изучено влияние примесей азота, бора и кислорода на параметры решетки, локальные искажения, стабильность и электронную структуру силикокарбида Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>. Установлены предпочтительные позиции примесей. Исследовано влияние примесей на деформационное поведение Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> посредством моделирования аксиального растяжения и анализа изменений длин связей в зависимости от величины деформации.

## 2. Модели и метод расчета

Как известно, Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> имеет гексагональную слоистую структуру (пространственная группа P63/mmc, Z = 2) из чередующихся плоских сеток атомов кремния и блоков карбида титана, содержащих два слоя октаэдров CTi<sub>6</sub> [1–3]. Атомы титана занимают две структурнонеэквивалентных позиции Ti1 и Ti2. Атомы Ti2 связаны с атомами кремния и углерода, а атомы Ti1 локализованы в карбидных слоях, и структура Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> рассматривается как последовательность гексагональных слоев -Si-Ti2-C-Ti1-C-Ti2-Si-.

Расчеты Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> выполнены методом проекционных присоединенных волн (projector augmented-wave — PAW) с использованием пакета Vienna *Ab initio* Simulation Package (VASP) [17,18] и обобщенного градиентного приближения для обменно-корреляционного потенциала [19]. Интегрирование в зоне Бриллюэна проводилось по  $10 \times 10 \times 6 k$ -точкам, кинетическая энергия обрезания выбрана равной 350 eV. Для расчета атомных и структурных релаксаций использован градиентный метод с условием сходимости по силам 0.01 eV/Å.

## 3. Результаты и обсуждение

Оптимизированные параметры решетки и координаты атомов в  $Ti_3SiC_2$  a = 3.076 AA, c/a = 5.7636,



**Рис. 1.** Полные и парциальные (пунктирная линия — плотность состояний углерода, бора, азота или кислорода) плотности состояний для Ti<sub>3</sub>Si(C, X)<sub>2</sub>. Уровень Ферми соответствует нулевой энергии.

 $z_{\rm Ti} = 0.135$  и  $z_{\rm C} = 0.067$  находятся в хорошем согласии с недавно полученными экспериментальными данными (a = 3.0575 Å и c/a = 5.7640,  $z_{Ti} = 0.1355$ и  $z_{\rm C} = 0.0722$  [20]). Расстояния между атомами титана и кремния (2.70 Å) существенно больше, чем расстояния в карбидном блоке (расстояния Ti1-C и Ti2-C равны 2.19 и 2.10 А соответственно, см. таблицу), и легкие примеси могли бы внедряться в поры между гексагональными Ті- и Si-слоями. Для того чтобы определить предпочтительную позицию для примесей, были рассчитаны полные энергии фаз Ti<sub>3</sub>SiC<sub>1.5</sub>X<sub>0.5</sub> и Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>X<sub>0.5</sub> (X = B, N u O), где примесный атом замещает углерод и межузельную позицию между слоями атомов Ті и Si соответственно. Сравнение этих двух позиций проведено с учетом разности полных энергий углерода и примеси. Расчет полных энергий углерода и бора выполнен для кристаллических структур графита и α-В<sub>12</sub>. Полная энергия О и N получена из расчетов молекул О<sub>2</sub> и N<sub>2</sub>, которые моделировались двумя атомами, расположенными в кубе с параметром решетки 10 А. Полученные оптимизированные значения межатомных расстояний (1.224 и 1.114 Å для O<sub>2</sub> и N<sub>2</sub> соответственно)

достаточно хорошо согласуются с экспериментальными значениями длин связей (1.207 и 1.098 Å) в этих молекулах. Расчеты на основе сопоставления полных энергий показали, что все примеси замещают углерод, а внедрение в поры между гексагональными слоями Ті и Si менее выгодно: на 0.12, 0.08 и 0.29 eV для N, O и B соответственно.

Установлено влияние примесей, замещающих углерод, на параметры решетки, локальные искажения и стабильность Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>. Примесь бора увеличивает, а азот уменьшает оба параметра гексагональной решетки; кислород вызывает уменьшение параметра *a* и увеличение параметра *c* (см. таблицу). Однако в случае примеси бора, несмотря на значительное увеличение параметров *a* и *c*, отношение *c/a* не меняется, а для Ti<sub>3</sub>SiC<sub>1.5</sub>N<sub>0.5</sub> и Ti<sub>3</sub>SiC<sub>1.5</sub>O<sub>0.5</sub> *c/a* возрастает, что свидетельствует об увеличении анизотропии химической связи. Расстояния Ti1–X и Ti2–X увеличиваются для X = B, O, а азот укорачивает их, при этом Ti<sub>2</sub>–Si-расстояние не меняется для Ti<sub>3</sub>SiC<sub>1.5</sub>B<sub>0.5</sub> и уменьшается при наличии азота и кислорода. Следует отметить, что параметр *a* гексагональной решетки убывает в ряду  $B \rightarrow C \rightarrow N \rightarrow O$ ,

Параметры решетки, межатомные расстояния, плотность на уровне Ферми и изменение энтальпии образования  $Ti_3Si(C, X)_2$ 

Параметр	Ti <sub>3</sub> SiC <sub>2</sub>	$Ti_3SiC_{1.5}B_{0.5}$	$Ti_3SiC_{1.5}N_{0.5}$	$Ti_3SiC_{1.5}O_{0.5}$
a, Å	3.076	3.097	3.057	3.046
<i>c</i> , Å	17.729	17.851	17.707	17.920
c/a	5.763	5.764	5.793	5.883
Ti2–Si, Å	2.70	2.70 (2.70)	2.70 (2.67)	2.70 (2.63)
Ti2- <i>S</i> , Å	2.10	2.16	2.09	2.17
Ti $1-X$ , Å	2.19	2.26	2.17	2.23
$N(E_{\rm F})$ ,	2.76	2.70	2.26	2.36
state/eV				
$\Delta H$ , eV/f.u.	0	+0.56	+0.01	+1.34

что отвечает изменению атомного радиуса примеси X (атомные радиусы равны 0.88, 0.77, 0.70 и 0.66 Å для B, C, N и O соответственно [21]).

Рассчитанные плотности состояний (ПС) для Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>, Ti<sub>3</sub>SiC<sub>1.5</sub>O<sub>0.5</sub>, Ti<sub>3</sub>SiC<sub>1.5</sub>N<sub>0.5</sub> и Ti<sub>3</sub>SiC<sub>1.5</sub>O<sub>0.5</sub> (рис. 1) позволили установить изменения в электронной структуре при наличии примесей. Уровень Ферми  $E_{\rm F}$  в Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> расположен вблизи псевдощели между связывающими и антисвязывающими состояниями и попадает на пик состояний титана, как это было показано в предыдущих расчетах электронной структуры Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> [16,22,23]. Плотность состояний на уровне Ферми  $N(E_{\rm F})$  довольно высокая, что определяет металлический характер проводимости в Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>. Вклад углерода в прифермиевской области незначителен, и величина  $N(E_{\rm F})$  определяется состояниями титана.

Уменьшение числа валентных электронов, обусловленное примесью бора, приводит к сдвигу  $E_{\rm F}$  в область связывающих состояний, но не меняет значения  $N(E_{\rm F})$  из-за наличия связывающих 2*p*-состояний бора вблизи уровня Ферми. Наблюдается уменьшение интенсивности пиков около -10 и -2.5 eV, обусловленных вкладами C2*s*- и C2*p*-состояний.

Увеличение числа электронов, обусловленное примесью азота, сдвигает  $E_{\rm F}$  в область высоких энергий, но  $E_{\rm F}$  остается в псевдощели, отделяющей связывающие и антисвязывающие состояния. В низкоэнергетической области ПС появляется новый пик при -15 eV, обусловленный вкладом 2*s*-состояний азота, увеличивается ПС вблизи -5 eV за счет N2*p*-состояний. Плотность состояний на уровне Ферми  $N(E_{\rm F})$  уменьшается за счет уменьшения вклада состояний титана, а вклад N2*p*-состояний в  $N(E_{\rm F})$  близок к нулю.

Дальнейшее увеличение числа электронов при частичном замещении углерода кислородом также сдвигает уровень Ферми в область высоких энергий. Пик 2*s*состояний кислорода расположен ниже -20 eV, а O2pсостояния вносят вклад в полную ПС в области энергий от -8 до -5 eV, существенно увеличивая полную ПС в этом интервале. В интервале наибольших значений ПС (область выше -5 eV до  $E_{\rm F}$ ) вклад кислорода отсутствует. Рассчитанное изменение энтальпии образования показывает, что азот почти не влияет на стабильность этого силикокарбида, а частичное замещение углерода бором или кислородом резко понижает стабильность, что обусловлено существенным увеличением длин связей Ti1-(O,B) и Ti2-(O,B), которые вносят основной вклад в когезию образования (см. таблицу).

В предыдущих работах [14,15,23] были исследованы микроскопические характеристики процесса разрушения для различных кристаллографических плоскостей и предсказаны критические напряжения и предпочтительные плоскости разрыва для  $Ti_3SiC_2$ . Моделирование аксиального растяжения кристалла показало, что с ростом параметра решетки *с* расстояния  $Ti_2-C$  (рис. 2) и Ti1-C (рис. 3) меняются незначительно, в то время как Ti2-Si-расстояние резко увеличивается (рис. 4). Для удлинения более 15% изменение длины связи Ti2-Si почти полностью соответствует деформации, т.е. эта связь способна аккумулировать большое напряжение



**Рис. 2.** Зависимость межплоскостных расстояний Ti1-X от величины аксиального растяжения в  $Ti_3Si(C,X)_2$ .



**Рис. 3.** Зависимость межплоскостных расстояний Ti2-X от величины аксиального растяжения в  $Ti_3Si(C,X)_2$ .



**Рис. 4.** Изменение межплоскостных расстояний Ti2–Si в  $Ti_3Si(C, X)_2$  в зависимости от величины аксиального растяжения. Сплошная линия соответствует ближайшей к примеси Ti2–Si-связи, пунктирная — удаленной от примеси Ti2–Si-связи.

при аксиальном растяжении, что объясняет механическую прочность Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>.

При наличии примесей расстояния Ti2-(C, B, N, O) увеличиваются в меньшей степени (рис. 3), чем расстояния Ti1-(C, B, N, O) (рис. 2). При растяжении более 6% длина связей Ti2-(C, B, N) не меняется, а связь Ti1-(C, B, N) удлиняется. Примесь азота слабо влияет на изменение Ti1-X- и Ti2-X-расстояний, более существенные изменения обусловлены примесями бора и кислорода. Следует отметить резкое увеличение длины связи Ti2-O для больших деформаций.

Как и для чистой фазы, наибольшее удлинение в  $Ti_3Si(C,X)_2$  наблюдается для Ti2-Si связей (рис. 4), которые почти полностью аккумулируют напряжения при растяжении Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>. В отсутствие аксиального растяжения примеси азота и кислорода уменьшают расстояние между ближайшими к примеси атомами Ti2 и Si, а бор не оказывает влияния на Ti2-Si-расстояния (см. таблицу). Однако при растяжении наблюдается анизотропия в изменении длин Ti2-Si-связей, ближайших к примеси и удаленных от примеси. В присутствии примесей ближайшие Ti2-Si связи меняются меньше, чем в Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>, т.е. примеси способствуют упрочнению ближайших Ti2-Si-связей по отношению к растяжению. Однако, как видно из рис. 4, расстояния между атомами Ti2 и Si, удаленными от примесей бора и кислорода, возрастают быстрее, чем в ТізSiC2. Таким образом, выполненные расчеты показывают, что примесь азота может способствовать упрочнению Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>, а примесь бора будет приводить к ламинатному расслоению изза существенного удлинения удаленных от бора Ti2-Siсвязей. Возрастание расстояний между атомами Ti2 и О при аксиальном растяжении Ti<sub>3</sub>Si(C,O)<sub>2</sub> также может привести к образованию трещины.

## 4. Заключение

С использованием неэмпирического метода функционала электронной плотности исследовано влияние примесей азота, кислорода и бора на параметры решетки, локальные искажения, стабильность и электронную структуру Ті<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>. Показано, что все примеси замещают углерод в карбидном блоке и поэтому не влияют на движение дислокаций, которое происходит между гексагональными слоями титана и кремния. Установлено, что бор и кислород дестабилизируют Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>, но возможно образование карбонитридных твердых растворов Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub> – xN<sub>x</sub> благодаря наличию ковалентных связей N-Ti-C. Проведено моделирование аксиального растяжения и установлено влияние примесей на деформационное поведение Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>. Показано, что азот может способствовать упрочнению Ti<sub>3</sub>SiC<sub>2</sub>, а бор и кислород должны приводить к ламинатному расслоению.

#### Список литературы

- R. Pompuch, J. Lis, L. Stobievski, M. Tymkiewicz. J. Eur. Ceram. Soc. 5, 283 (1989).
- [2] M.W. Barsoum. Prog. Solid State Chem. 28, 201 (2000).
- [3] J.Y. Wang, Y.C. Zhou. Ann. Rev. Mater. Res. 39, 415 (2009).
- [4] M.W. Barsoum, T. El-Raghy. J. Amer. Ceram. Soc. 79, 1953 (1996).
- [5] T. El-Raghy, A. Zavaliangos, M.W. Barsoum, S. Kalidinidi. J. Am. Ceram. Soc. 80, 513 (1997).
- [6] M.W. Barsoum, T. El-Raghy, C.J. Rawn, W.D. Porter, H. Wang, A. Payzant, C.R. Hubbard. J. Phys. Chem. Solids 60, 429 (1999).
- [7] M.W. Barsoum, T. Zhen, S.R. Kalidindi, M. Radovic, A. Murugaiah. Nature Mater. 2, 107 (2003).
- [8] Z.F. Zhang, Z.M. Sun, H. Zhang, H. Hashimoto, Adv. Eng. Mater. 6, 980 (2004).
- [9] T. Zhen, M.W. Barsoum, S.R. Kalidindi, M. Radovic, Z.M. Sun, T. El-Raghy. Acta Mater. 53, 4963 (2005).
- [10] Z.M. Sun, Z.F. Zhang, H. Hashimoto, T. Abe. Mater. Trans. 43, 432 (2002).
- [11] Z.F. Zhang, Z.M. Sun, H. Hashimoto. Mater. Lett. 57, 1295 (2003).
- [12] C.M. Fang, R. Ahuja, O. Eriksson, S. Li, U. Jansson, O. Wilhelmsson, L. Hultman. Phys. Rev. B 74, 054 106 (2006).
- [13] H.Z. Zhang, S.Q. Wang. Acta Mater. 55, 4645 (2007).
- [14] N.I. Medvedeva, A.J. Freeman. Scripta Mater. 58, 671 (2008).
- [15] Н.И. Медведева, А.Н. Еняшин, А.Л. Ивановский. ЖСХ 52, 806 (2011).
- [16] N.I. Medvedeva, D.L. Novikov, A.L. Ivanovskij, M.V. Kuznetsov, A.J. Freeman. Phys. Rev. B 58, 16 042 (1998).
- [17] G. Kresse, J. Furthmuller. Phys. Rev. B 54, 11169 (1996).
- [18] G. Kresse, J. Hafner. J. Phys.: Cond. Matter 6, 8245 (1996).
- [19] J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- [20] E.H. Kisi, A.A. Crossley, S. Myhra, M.W. Barsoum. J. Phys. Chem. Solids 59, 1443 (1998).
- [21] C. Kittel. Introduction to solid state physics. 7th ed. Wiley, N.Y. (1996). P. 673.
- [22] Н.И. Медведева, А.Л. Ивановский. ЖНХ 43, 462 (1998).
- [23] J.Y. Wang, Y.C. Zhou. Phys. Rev. B 69, 144108 (2004).